

1 日 目 9 月 2 日 (水)	1日目 2026年9月2日 (水)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	ウェルカムレセプション
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	朱鷺メッセ 4F
	13:00~17:00	13:00~17:00 電気学会 A部門 研究者育成セミナー	—	—	—	—	—	—	企業ブース (展示準備)	—
	18:00~19:00	—	—	—	—	—	—	受付	—	18:00 ~ ウェルカム レセプション

2 日 目 9 月 3 日 (木)	2 日目 2026年9月3日 (木)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	—
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4 F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	—
	8 : 45～10 : 15	3-A-a1 誘電・絶縁材料Ⅰ (5)	3-B-a1 【企画セッションⅠ】 ポストコロナ社会を支える 先端ナノ材料と有機デバイ ス技術の最前線	3-C-a1 教育・研究 (4)	3-D-a1 磁性材料・磁気応用・マイク ロ磁気Ⅰ (4)	3-E-a1 計測Ⅰ (5)	3-F1 10 : 00～11 : 45 ポスター (YPC・一般) (48・4)	受付	9 : 00～ 企業ブース (展示)	—
	10 : 30～12 : 00	—	一本分野の発展に貢献して きた研究者の業績の継承と 発展—	—	—	—			企業ブース (展示)	—
	昼休み	ランチョンセミナー	—	—	ランチョンセミナー	—	ポスターボード 撤去作業 机・椅子 セッティング作業		企業ブース (展示)	—
	13 : 00～14 : 30	3-A-p1 誘電・絶縁材料Ⅱ (5)	—	3-C-p1 13 : 30～17 : 20 【特別シンポジウム】 革新的パワーエレクトロ ニクスの研究開発最前線	3-D-p1 磁性材料・磁気応用・マイク ロ磁気Ⅱ (5)	3-E-p1 計測Ⅱ (4)			企業ブース (展示)	—
14 : 45～16 : 15	3-A-p2 誘電・絶縁材料Ⅲ (6)	3-B-p1 【企画セッションⅡ】 電力機器・設備の絶縁劣 化・異常診断技術および評 価技術の最新動向	3-D-p2 電磁界理論、電磁環境 (5)		3-E-p2 プラズマ (6)	—			～16 : 30 企業ブース (展示)	—
16 : 30～18 : 00	—	—	3-D-p3 【企画セッションⅢ】 魅力的なプレゼン資料の作成 法		—	—	—		—	

3 日 目 9 月 4 日 (金)	3日目 2026年9月4日 (金)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	懇親会
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4 F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	日航ホテル4F 朱鷺
	8 : 45～10 : 15	4-A-a1 誘電・絶縁材料Ⅳ (6)	4-B-a1 【企画セッションⅣ】 Advanced Nanomaterials and Devices	4-C-a1 放電基礎・現象・応用 Ⅰ (5)	4-D-a1 【企画セッションⅤ】 えれき塾；A部門における STEAM型イベントの企画 とそのコンテンツの展開	—	—	受付	9 : 00～ 企業ブース (展示)	—
	10 : 30～12 : 00	4-A-a2 誘電・絶縁材料Ⅴ (5)		4-C-a2 放電基礎・現象・応用 Ⅱ (4)		—	—		企業ブース (展示)	—
	昼休み	ランチョンセミナー	—	—	ランチョンセミナー	—	—		企業ブース (展示)	—
	13 : 15～17 : 30	—	—	—	—	—	4-F-p1 【特別企画】 13 : 15～13 : 30 会長挨拶 13 : 30～15 : 30 「未来エネルギー・情報のた めの材料・デバイス・システ ム科学」 【特別講演】 15 : 45～16 : 45 【表彰式】 16 : 45～17 : 30		企業ブース (展示)	—
									～16 : 30 企業ブース (展示)	—
						—			懇親会 受付	
18 : 00～19 : 30	—	—	—	—	—	—	—	—	18 : 00 ～ 懇親会	

4 日 目 9 月 5 日 (土)	4日目 2026年9月5日 (土)									
	会場名	会場 A	会場 B	会場 C	会場 D	会場 E	会場 F	受付	企業ブース	—
	会議室名	中会議室301A	中会議室301B	中会議室302A	中会議室302B	小会議室303-304	国際会議室(4F)	4Fホワイエ	3Fホワイエ	—
	8:45~10:15	5-A-a1 誘電・絶縁材料Ⅵ(6)	—	5-C-a1 【企画セッションⅥ】 Society5.0に資する高周波 マイクロ磁気デバイスの研 究および実用化動向	5-D-a1 【企画セッションⅦ】 電気絶縁材料開発におけ るインフォマティクス応 用	—	—	受付	9:00~ 企業ブース (展示)	—
	10:30~12:00	5-A-a2 誘電・絶縁材料Ⅶ (6)	10:00~11:30 子供 電気工作教室			—	—		~12:00 企業ブース (展示)	—